

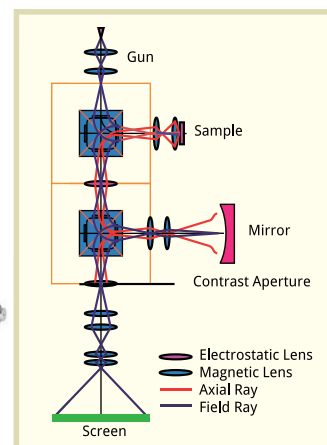
# 球面収差補正で高精細なLEEMイメージを実現—平面分解能1.6 nm— FE-低エネルギー電子顕微鏡/光電子顕微鏡 FE-LEEM/PEEM P90 シリーズ

COMPACT LOW ENERGY ELECTRON AND PHOTOELECTRON EMISSION MICROSCOPE

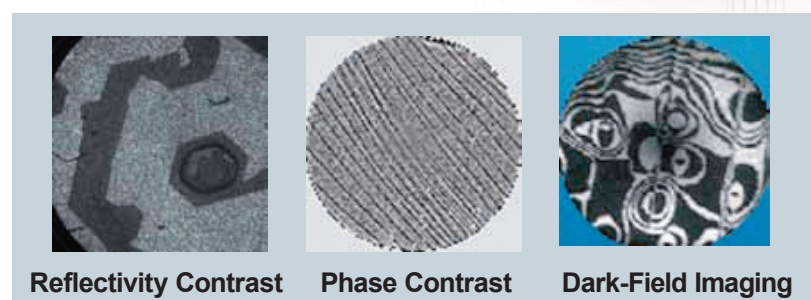
コンパクト・高分解能

## 特長

- 高輝度・低エネルギー分散FE-電子銃
- 高性能静磁場レンズ・ディフレクタ
- 球面収差補正機能
- D<sub>2</sub>, Heランプ光源搭載可能
- 高精度 5軸ピエゾ試料ステージ
- 高機能試料ホルダー
- 高い拡張性
- オールインワン設計
- ターンキーシステム



## LEEM

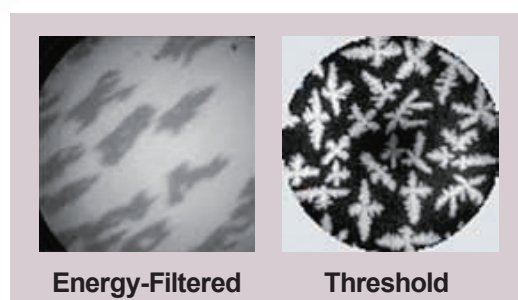


Reflectivity Contrast

Phase Contrast

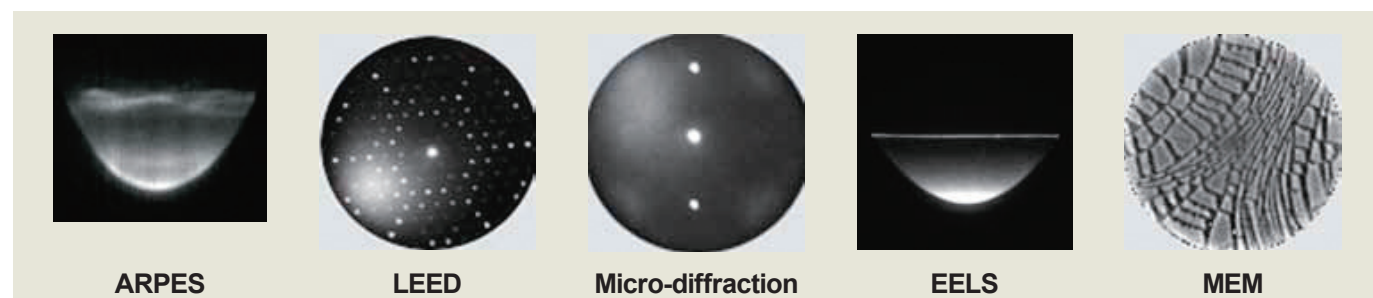
Dark-Field Imaging

## PEEM



Energy-Filtered

Threshold



ARPES

LEED

Micro-diffraction

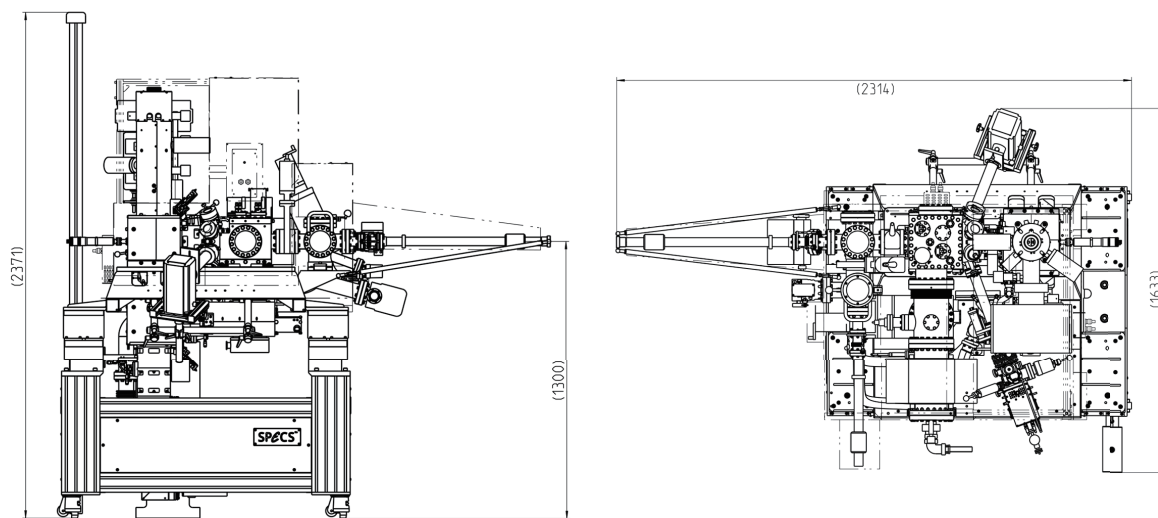
EELS

MEM

# 仕様

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 空間分解能                 | Fe-LEEM P90 : 保証値 5 nm<br>(最高分解能 : 4.2 nm)<br>Fe-LEEM P90 AC : 保証値 3 nm,<br>(最高分解能 : 1.6 nm) |
| 観察視野                  | 800 nm ~ 100 μm  |
| 倍率                    | 400 x ~ 50000 x  |
| エネルギー分解能              | 分光測定 : < 250 meV<br>イメージング : < 1.7 eV  |
| Kinetic エネルギー         | 通常 15 KeV<br>最小 2 KeV  |
| 占有面積                  | 1.6 m × 2.3 m (高さ 2.3m)  |
| スタート・エネルギー            | 最大 1000 eV   |
| ベース・プレッシャー            | $2 \times 10^{-10}$ mbar   |
| LEEM スポットサイズ          | < 40 μm<br>最小 200 nm<br>(マイクロ・ディフラクションのアーチャー使用時)   |
| 電子ビームのエネルギー幅          | < 300 meV  |
| 試料ステージの位置再現精度         | ~ 500 nm   |
| 最高試料加熱温度<br>(イメージング時) | 最大 1500 K  |

## 寸法図



Top View and Side View, Dimensions in mm

**TII** 株式会社 東京インストルメンツ  
**TOKYO INSTRUMENTS, INC.**  
 Mutual Satisfaction

本社 : 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6-18-14  
 大阪営業所 : 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-46 新大阪北ビル  
 WEB Site : <http://www.tokyoinst.co.jp/>

TEL 03-3686-4711 FAX 03-3686-0831  
 TEL 06-6393-7411 FAX 06-6393-7055

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。  
(製品の仕様、性能、価格等はカタログ発行当時のものです)
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

カタログNo. SPEE-3501A  
 2016-0120